### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-201214

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

個公開 昭和61年(1986)9月5日

G 02 F # G 02 B 1/01 5/18 5/30 Z-7448-2H 7529-2H 7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

光変調装置 69発明の名称

> 20特 願 昭60-43237

29出 願 昭60(1985)3月5日

琧 明 田 四発 者

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 勿出 願 人 キャノン株式会社

弁理士 丸島 何代 理 儀一

1. 発明の名称

光变調装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 光学的等方性を有する第1の物質と、光学 的 異 方 性 と 光 学 的 等 方 性 の 2 つ の 状 態 が 制 御 可 能な第2の物質との界面でグレーティングを形 成し、前記第2の物質が光学的異方性の状態に 於て、任意の偏光特性を有する入射光の互いに 直交する2つの偏光成分が、前配光学的異方性 を有する第2の物質に対して感じる個々の屈折 率 П 1 , П 2 と前記第 1 の物質の屈折率 П g と に所定の関係を与える事により、前記任意の偏 光特性を有する入射光を前記グレーティングで 回折せしめ、前記第2の物質が光学的等方性の 状態に於て、該光学的等方性を有する第2の物 質の屈折率 N i と前記第 1 の物質の屈折率 N g が ほぼ等しくなるように設定した事を特徴とする 光 変調 装 置。

(2)前記グレーティングが三角波状を成し、そ

の厚みをT、入射光の波長を入りとした時、

 $|n_1-n_g| \cdot T \cong m_1 \lambda_0 \quad (m_1=1,2,3,---)$ 

 $|\Pi_2 - \Pi_g| \cdot T \cong m_2 \lambda_0 \quad (m_2 = 1, 2, 3, ----)$ 

を同時に満足する事を特徴とする特許請求の範 囲第(1)項記載の光変調装置。

(3)前記グレーティングが矩形状を成し、その 厚みをT、入射光の波長をλοとした時、

 $| n_1 - n_g | \cdot T \cong (\frac{1}{2} + \ell_1) \cdot \lambda_0 (\ell_1 = 0, 1, 2, ---)$ 

 $| n_2 - n_g | \cdot T \cong (\frac{1}{2} + \ell_2) \cdot \lambda_0 (\ell_2 = 0, 1, 2, ---)$ 

を同時に満足する事を特徴とする特許請求の範 囲第(1)項記載の光変調装置。

(4)前記グレーテイングが正弦状を成し、その 厚みをT、入射光の波長をλοとした時、

$$| n_1 - n_g | \cdot T \cong \lambda_0 (k_1 - \frac{1}{4} + \frac{0.050661}{4 k_1 - 1})$$

$$-\frac{0.053041}{(4 \text{ k } 1-1)^{3}} + \frac{0.262051}{(4 \text{ k } 1-1)^{5}} - \cdots$$

 $(k_1 = 1, 2, 3, ----)$ 

$$| n_2 - n_g | \cdot T \cong \lambda_0 (k_2 - \frac{1}{4} + \frac{0.050661}{4 k_2 - 1} - \frac{0.053041}{2 k_2 - 1} + \frac{0.262051}{2 k_2 - 1}$$

 $(k_2 = 1, 2, 3, ----)$ 

を同時に満足する事を特徴とする特許請求の範

囲第(1)項記载の光変調装置。

## 3. 発明の詳細な説明

## (1)技術分野

本発明は、光表示用、光記録用、光結合用、 光通信用、光演算用等の各種装置に好適な光変 調装置に関する。

## (2) 従来技術

従来、光変調装置として代表的なものには P L Z T 、B S O 等の電気光学結晶や液晶を利用 した装置があった。

電気光学結晶を利用した装置には、スライス した電気光学結晶面上に交差した櫛状電極を設 けて前記電気光学結晶の前後に偏光子かするで、 子を備え、前記櫛状電極に電光子かするで、 子もり結晶内の複屈折性を変化を透過は大きな 気光学結晶、検光子より成るを透過は大きな 東の制御を行なう装置がある。これ 東の影響性に優れて単色光に対する 東の影響性に優れて単色光に対する 東の影響性に優れて単色光に対する 東の影響性に優れて単色光に対する 東の影響性に優れて単色光に対する 東の影響性に優れて単色光に対する 大生も高いが、通常、 数K V と非常に高く、しかも大面積比が困難で

3

# (3) 発明の概要

本発明の目的は、従来の欠点を除去し、任意 の偏光特性を有する入射光に対して高い光利用 効率を備えた光変調装置を提供する事にある。

上記目的を達成する為に、本発明に係る光変 調装置は、光学的等方性を有する第1の物質 と、光学的異方性と光学的等方性の2つの状態 が制御可能な第2の物質との界面でグレーティ ングを形成し、前記第2の物質が光学的異方性 の状態に於て、任意の偏光特性を有する入射光 の互いに直交する2つの偏光成分が、前記光学 的異方性を有する第2の物質に対して感じる個 々の屈折率 N 1 、 N 2 と前記第 1 の物質の屈折 率 Ngとに所定の関係を与える事により、前記 任意の偏光特性を有する入射光を前記グレーテ イングで回折せしめ、前記第2の物質が光学的 等方性の状態に於て、該光学的等方性を有する 第2の物質の屈折率niと前記第1の物質の屈 折率Ngがほぼ等しくなるよう設定した事を特 徴としている。

あるという欠点を有していた。

上述した代表的な光変調装置はもちろんのこと従来の大部分の光変調装置は、人射光として特定の偏光特性を有する光、通常直線偏光させたものを利用する為に、ランダムな偏光を有する入射光に対して偏光板を使用せざるを得ず、入射光が偏光板を透過する際に光利用効率が大きく低下していた。

4

上記屈折率 n 1 、n 2 及び n g の間に於る所定の関係は、上記グレーティングの形状により異なり、例えば、入射光の披長を λ 0 、グレーティングの形状が三角披状の場合、以下の式で表わす事ができる。

 $|n_1 - n_g| \cdot T \cong m_1 \lambda_0 \quad (m_1 = 1, 2, 3, ----)$ A.  $\supset$ 

 $|n_2 - n_{g}| \cdot T \cong m_2 \lambda_0 \quad (m_2 = 1, 2, 3, ----)$ 

. 又、矩形状グレーティングの場合は、

 $| n_1 - n_g | \cdot T \cong (\frac{1}{2} + \ell_1) \lambda_0 \quad (\ell_1 = 0, 1, 2, ----)$   $\mathbb{R} \supset .$ 

| n<sub>2</sub>-n<sub>g</sub> | • T≅ (½+ l<sub>2</sub>) λ<sub>0</sub> (l<sub>2</sub>=0,1,2,----) 更に、正弦波状グレーティングの場合は、

$$|n_1 - n_g| \cdot T \cong \lambda_0 (k_1 - \frac{1}{4} + \frac{0.050661}{4k_1 - 1})$$
  
 $-\frac{0.053041}{(4k_1 - 1)^3} + \frac{0.262051}{(4k_1 - 1)^5}$ 

 $(k_1=1,2,3,---)$ 

且つ

$$| n_2 - n_g | \cdot T \cong \lambda_0 (k_2 - \frac{1}{4} + \frac{0.050661}{4k_2 - 1})$$

$$- \frac{0.053041}{(4k_2 - 1)^3} + \frac{0.262051}{(4k_2 - 1)^5} + \cdots$$

$$(k_2 = 1, 2, 3, ----)$$

で表わす事ができる。

上記第1の物質としては、例えばガラス、 SiO2, MgO, KCl, NaCl, KBr, SrTiO3、PMMA(ポリメチル・メタク リレート) , ポリスチレン, ポリカーバネート, P V K (ポリビニル・カルバゾール) , エポキ シ樹脂、フォトレジスト等が好適である。 又上 記第2の物質は温度、圧力、電界、磁界等によ り光学的状態が変わるもので、例えば液晶、P LZT, LiTaO3, Gd2 (MoO4)3, Bi 4 T 3 O 12, B 12 S i O 20, B a T i O 3, Ba2NaNbO15, SbSI, PbTiO3, NaNO2, CuCl, TiO2, MgF2等 が挙げられる。特に、ネマチツク液晶や強誘電 性液晶は屈折率差(異常屈折率と常屈折率の差) が大きく、制御方法が簡単である為に好適な物 留である。

上記グレーティングの形状は、矩形状、三角 被状、正弦被状等各種形状を使用する事が可能 で、該グレーティング形状、第1及び第2の物

7

## (4) 実施例

第1 図及び第2 図は本発明に係る光変調装置の構成例で、1 は光学的異方性と光学的等方性の2 つの状態を制御する事が可能な物質(以 学 的 供 が 明 と 記 ま の と で の 状態 を 制御する事が可能な 物質 (以 学 的 供 が 所 供 が 質 と 記 ま の と に と が 明 と し み と は 透 明 と ー タ 、 4 は 透 明 と ー タ 、 4 は 透 明 と ー タ 、 4 は 透 明 に ー タ 、 4 は 透 明 に ー タ 、 4 は 透 明 に い か の の 印 は が の で か 質 1 の の 光 で の 課 が に か る の 光 学 的 状態 可 ひ レーティング 調 方 向 の 低 面 垂 直 方 向 の は が レーティング 満 方 の の に 光 成 分 の 内 の 印 は グ レーティング 満 方 の の に 光 成 分 の ト ・ グ の 配 列 方 向 を 指 し が レーティング 満 た い る ・

第1図(A)に係る装置は、光学的状態可変物質1と光学的等方性物質2によって三角披状グレーティングが形成され、光学的状態可変物質1に接して透明ヒータ3が設けられている。透明ヒータ3により光学的状態可変物質1の状態を変化させてグレーティングの特性を制御し、入射光5の変調を行なう。以下、第1図

質は本装置の作成上に於る容易性、仕様に係る条件等により決定されるものである。又、第1の物質の状態を変化させる手段としては、前述の様に温度(熱)、圧力、電界、磁界等が有り、温度で制御する場合はヒーター、電界で制御する場合は領極等を装置に備える。

本光変調装置は、任意の偏光特性を有する
光、即ち通常の光想より出射されるランダムな
に光成分を持つ光を互いに直交する2のの光と考え、各々の偏光的
に対する光変調を同時に行なう事によりの
の光と特性を有する光に対する変調を可能と及の
のの光と表え、各々のの光と表え、各々のの場合の
に対する光変調を同時に行なう事にです。
のの光と表え、各々のの場合は
ながって、大変調を使用する場合は本数ののでは
ないって、透過光を利用する事がで置いない
はがある。
は対は使用光に対して透明性を有しなあい
はならず、反射光を使用する場合は
ないた
はならず、反射光を使用する場合は
ないた
はがたらがある。

8

(B) ~ (D) に示す装置は全て三角波状グレーティングを有し、光学的状態可変物質 1 の状態を透明ヒータ 3 を介し熟によって制御する 数置であるが、(B) に於ては透明甚板 4 自体をグレーティング状即ち光学的等方性物質 2 とし、(C) に於ては透明ヒータ 3 をグレーティング面に沿って透明ヒータ 3 を形成したものである。

第2図(A)、(B)はグレーティング形状の異なる光変調装置の一例であり、(A)に於ては光学的状態可変物質 1 と光学的等方性物質 2 の界面で矩形状グレーティングを形成し、(B)に於ては正弦波状グレーティングを形成している。本実施例の装置でも光学的状態可変物質 1 の状態を制御する為に透明ヒータ 3 を設けている。

以上、第1 図及び第2 図に示した実施例に於て光学的状態可変物質1 の光学軸はグレーティング構方向を向いている。しかし初期状態に於

る光学軸の方向は入射光の進行方向を向いていない限り任意の方向に設定できる。但し、好ましくは入射光の進行方向に対する光学軸方向の両方向を含む平面内に於る角度のが0 ≥ 3 0 °であれば、より良好に本装置は機能する。この角度のは光学的状態可変物質、入射光の偏光特性、作成上及び装置の仕様に対する条件等により決まる。

以下、図面を用いて本光変調装置の変調原理を説明する。第3図は本光変調装置の変調原理説明図で、7,7は高次回折光、8は零次透過光を示し、第1図と同じ部材及び記号には同番号を付してある。尚、装置の構成は第1図(A)の装置と同じものである。

一般にランダムな偏光方向を持つ光5は、図示している様に、その成分を直交する2つの偏光成分6,6′に分けて考える事が可能である。本光変調装置の透明ヒータ3に電流を通電していない静的状態に於て、光学的状態可変物質1は光学的異方性を示し、その光学軸はグレーテ

1 1

ここで入射光5の被長をλ0、入射光の両偏 光成分6、6′に対するグレーデングを形成する 物質1、2の屈折率差を△ N、グレーティング 層の厚さをTとすれば、第3図に示す様な三角 波状グレーテングに於る零次透過回折光8の回 折効率70は次の(1)式で表わせる。

 $\eta_0 = \sin \alpha c^2 \left(\pi \frac{\Delta n \cdot T}{\lambda \Omega}\right)$  ---- (1)

(1) 式に於て、ムロ・T=0の時 70 = 1
即ち生じる回折光は零次透過光8のみとなり高次回折光7,7は発生しない。又、ムロ・T=四かるのでは発生しない。又、ムロ・T=のかる過回折光8は発生せず、入射光5の時つエネルギーの殆どは高次回折光7,7のエネルギーとなり出射する。従って、本率 Nのいれ 一となり出射する。従って、本率 Nののののが、光学的状態可変物質1の屈折率 Nを加入射光の波長入0の間で下記(2)、式を満足する様に設けている。では、入りを満足し齢的状態に於て零次透過回折光8は発生しなしました。この時の時の時では、入りを満足しかの状態に於て零次透過回折光8は発生しな

イング摘方向を向いている。この時、入射光ちの陽光成分6は陽光方向が光学的状態可変物第1の光学軸方向と一致し、光学的状態可変物第1の異常屈折率neを感じる。又、偏光の分が光学的状態可変物質1の光学の状態可変物質2に対しては、入射光ちの互いに直交する偏光成分6及があられ、各々屈折率noとng、neとngがるがレーテングを感じる。

次に透明ヒータ3によって光学的状態可変物質1に熟を加え、光学的状態可変物質1の温度以上にする。この時、光学的状態可変物質1は等方性物質に変化し、入射光5の任意の偏光成分、即ち偏光成分6・6′は共平の圧を感じる。従って、任意の偏光成分が屈折率りまた。と1、2の偏光成分を感じる事になる。

1 2

い。又、透明ヒータ3によって光学的状態可変物質1の状態を光学的等方性(屈折率 D i)に変えた時は、入射光5は全てグレーティングを透過し零次透過回折光8となり出射する。

$$| ne - ng | \cdot T = m1 \lambda_0 \quad (m = 1, 2, ---)$$
  
 $| n_0 - ng | \cdot T = m2 \lambda_0 \quad (m = 1, 2, ----)$   
 $| n_g = n_i \quad (2)$ 

以上の説明から解る様に、ランダムな偏光成分を有する光であっても、その互いに直変調を行なう事により、光利用効率を低下させる事なく変調可能である。又、本実施例では、垂直入射光に対し零次透過回折光を変調光として、取り扱ったが、入射角度は任意の角度でも構わない。 として利用する光は高次回折光でも構わない。 は、第2図を用いて述べた様に、光学的状態

尚、第2図を用いて述べた様に、元子的状態可変物質1と光学的等方性物質2によって形成されるグレーティングの形状は各種形状が存在する。この場合、(1)式で示した雰次透過回折光の回折効率70の式はグレーティング形状

によって異なる。例えば、第2図(A)に示す 矩形状グレーテイングに於ては次の(3)式に なる。

$$70 = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \cos \left( 2 \pi \frac{\triangle \Pi T}{\lambda \Omega} \right) \right\} \qquad ---- (3)$$

但し、(3) 式の場合、 $\triangle nT = \ell_1 \lambda_0 (\ell_1 = 0.1.2 - 1.$ 

以下、第2図(A)に示す本光変調装置の作成過程と性能評価の結果を記す。尚、光学的状態可変物質1としてネマチック液晶を、光学的等方件物質2として光学ガラスを用いた。

第 4 図は本光変調装置の作成過程を示す図で、第 2 図(A)と同じ部材には同番号を付す。又、9 はグレーテイング満方向に配向した液晶、10 は A 2 膜を示す。

BaF2ガラス(25×25×1mm³) の両面を光学研磨 及び洗浄して作成したガラス基板2上にRD-2000N(日立製作所製ネガ型レジスト)をス ピナー塗布し厚さ8000人のレジスト膜を 形成した。このガラス基板2を140℃、20

15

N e レーザ (λ = 6 3 2 8 Å) を光源として用 い、ランダムな偏光成分を有する光を直接垂直 入射させて零次透過回折光の回折効率を測定し た。 測定系の周囲温度を約20℃に保ち透明 ヒータ3に電流を印加しない状態に於て、液晶 9はネマチック相でありグレーティング摘方向 に配向している。この時、グレーテイングの配 列方向に平行な偏光成分は液晶9の常屈折率 Ω 0 = 1.5 2 を感じ、グレーティングの博方向 に平行な偏光成分は液晶9の異常屈折率Neェ 1.72を感じる。又、ガラス基板2に対しては 阿倡光成分屈折率 Ng=1.57を感じる。従っ て両偏光成分共 (1) 式に於て 70 = 0と成 り、入射光は全て高次回折光となって出射し零 次透過回折光は発生しなかった。次に透明ヒー タ3に電流を印加したところ、液晶9は液層即 ち光学的等方性物質に変化して等方性屈折率 N i = 1.5 7 を示した。この時 N i = N g であ る為、入射光に対してグレーティングは存在し ない事になる。(△N・T=0)従って、入射

分間のブリベーキングした後、適紫外光によるマスク露光、現像処理及びリンス処理を行ない、ピッチ 6 μmのレリーフ状レジストグレーティングを形成した。次にCF4-O2混合ガスを用いたイオン・エッチング法によりガラス基板2を探さ6.3 μmに食刻し第4図(A)に示す基板を製作した。

続いて、上記基板同様の処理を施したBaF2ガラス基板4(50×25×1mm³)を用意し、イオンプレーテイングによりガラス基板4に透明ヒータ3としてITO膜を第4図(B)に示す所定位置に成膜した。その後、上記ITO膜の両端にA2膜10から成るリード部を分子ビーム蒸着法で厚さ1000人に成膜した。

上記 2 枚の基板を、グレーティング領域と透明ヒータ領域とが相対する様に貼り合わせ、 ネマチック液晶 E 7 (B D H 社製) 9 を充塡後シールした。 (第 4 図 (C))

第 4 図 ( C ) に示す本光変調装置に、 H e -

16

光は紫通りして零次方向へ出射した。 測定によれば、零次透過回折光の回折効率は電流通電の 有無により 1 %から 8 0 %の間で変化した。

## (5) 発明の効果

以上説明した様に、本発明に係る光変調装置は、偏光板が不要であり、任意の偏光特性を有する光に対し高い光利用効率を備えた装置である。

## 4. 図面の簡単な説明

第 1 図及び第 2 図は本発明に係る光変調装置の構成例を示す図。 第 3 図は本光変調装置の変調原理説明図。第 4 図は本光変調装置の作成過程の一例を示す図。

1 ----光学的状態可変物質

2 ----光学的等方性物質

3 ---- 透明 ヒーター

4 ---- 透明基板

5 ---- 入射光

6,6'----互いに直交する偏光成分

7 . 7'---高次回折光

特開昭61-201214 (6) --零次透過(回折光) ¥ 10----A 2 電極 (A) 出願人 代理人 (B) (c) (D)



